

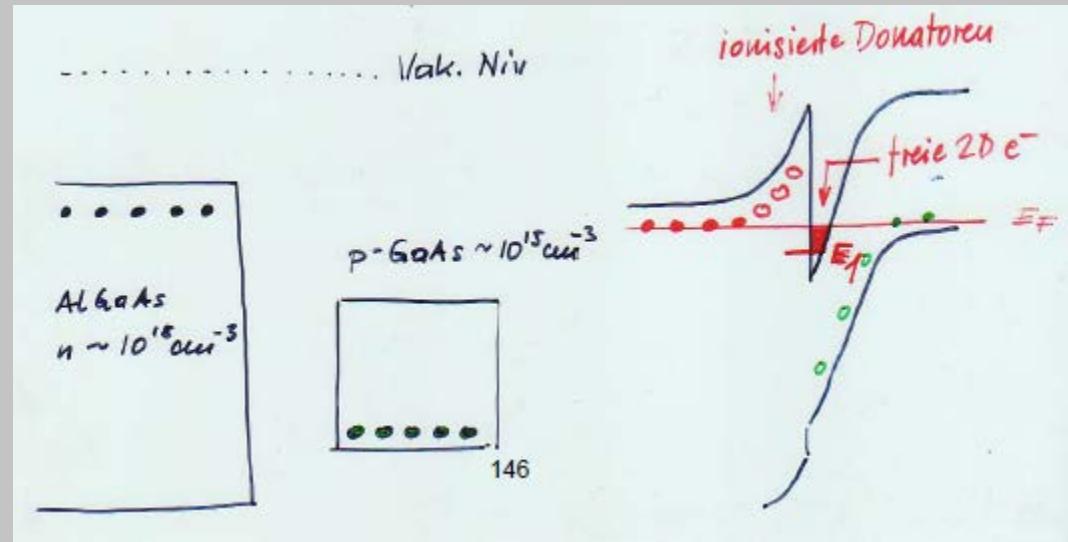
Modulationsdotierung

Die Dotierung ist extrem wichtig für die Funktion von HL-Bauelementen. Damit ein Donator (Akk.) Atom aber "wirksam" ist, muss es ionisiert werden. Dann aber werden die freien Lad.tr. sehr effektiv gestreut (ionisierte Stkt. Streuung)

Die Modulationsdotierung erlaubt die (selektive Dotierung) Trennung von Ladungsträgern und ionisierten Stkt.

dies gibt: sehr hohe Beveglickeit
kein Auströmen bei tiefen Temp.

Modulationsdotierung



146

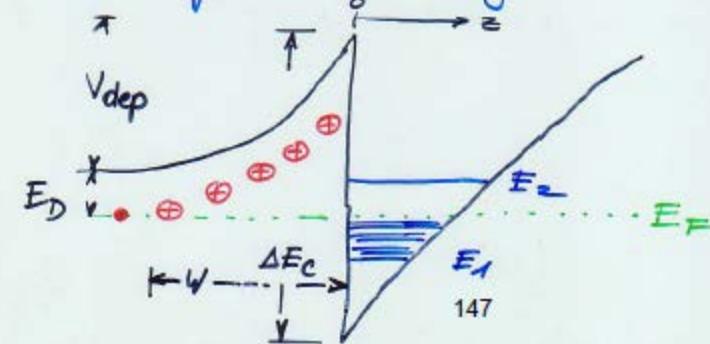
Modulationsdotierung

Drei Mechanismen bestimmen die Ladungsverteilung in der Struktur und müssen selbstkonsistent betrachtet werden.

- 1) Die elektrischen Ladungen nahe dem Interface bestimmen die Bandverbiegung im Kanal und der Barriere
- 2) Die Energie der quantisierten (2D) Zustände im Kanal
- 3) Im Thermodyn. Gleichgewicht bestimmt die Fermi-Energie die Konz. der beweglichen Elektronen im Kanal.

Modulationsdotierung

Seien nun eine Abschätzung
wobei $P_{dots} = 0$ und ein ∞ -hohes
Dreieckspotential angenommen wird.



Modulationsdotierung

Nach dem Transfer von N_s Elektronen in den Kanal ist das \tilde{E} -Feld (gauss) gleich

$$E = N_s e / \epsilon_0 \epsilon$$

$$\phi(z) = - Ez \quad (\text{Potential})$$

E Feld einer Flächenlad.

damit

$$E_1 = \left(\frac{\pi \hbar^2}{2 m^*} \right)^{1/3} \left(\frac{9}{8} \pi e^2 N_s / \epsilon \epsilon_0 \right)^{2/3}$$

Bei $T=0$ und thermodyn. Gleichgew. erhält man den höchsten gefüllten Zustand bei E_F

$$E = E_1 + \frac{N_s}{S_{2D}} = E_1 + \frac{\pi \hbar^2 N_s}{m^*}$$

2D-Zustandsdichte

Modulationsdotierung

Dies ist aber gleich der Vol. Fermi E. in
 AlGaAs, die am Interface durch das
 Elektrostat. Pot. der ionisierten Donatoren,
 V_{dep} , heruntergedrückt wird.

$$V_{dep} = - \int_{z=0}^W F dz = \int_0^W \frac{e N_D z}{\Sigma \epsilon_0} dz = \frac{e N_D W^2}{2 \Sigma \epsilon_0}$$

die gibt (bei $z=0$) mit Anlage mit Dicke w

$$\Delta E_C = E_1 + \frac{\pi \hbar^2 N_S}{m^*} + E_D + e V_{dep}$$

wobei angenommen wird, dass die
 Fermi E. am Donatorniveau "gepinnt" ist.

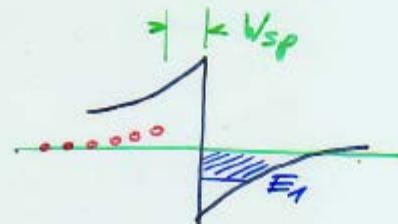
Mit $N_S = N_D W$ erhält man

$$\Delta E_C - \underbrace{\frac{e^2 N_S^2}{2 \Sigma \epsilon_0 N_D}}_{e V_{dep}} - E_D = E_1(N_S) + \frac{N_S \pi \hbar^2}{m^*}$$

Modulationsdotierung

Diese (und andere) Rechnungen berücksichtigen allerdings nicht, dass für endl. ΔE_c die Wellenfunktion der Elektronen in die Barriere eindringt, was zu Coulomb Str. führt.

Bei realen Strukturen wird daher eine undotierte "spacer" Lage in der AlGaN Barriere eingebaut. (W_{sp})



Modulationsdotierung

Eine Vergrößerung von W_{sp} führt zu kleinerer Coulomb Wd. und damit zu größerer Beweglichkeit der Elektronen

Grenze für W_{sp} :

Das \vec{E} -Feld im spacer ist konst (keine Raumlad.). Daher baut sich Pot. auf, das aber keine Ladungen in den Kanal gibt (keine Donatoren)

Daher verringert größeres W_{sp} die Ladungsträger Konz. N_s

Modulationsdotierung

Die Stromung von Ladungsträgern im Kanal durch Donatoren in der Barriere hängt vom Formfaktor der Coulomb W.W ab

$$q = 2k (\sin \theta / 2)$$

Bei tiefen Temperaturen ist κ_{eff}

Modulationsdotierung

d.h. k_F nimmt zu mit steigendem N_S

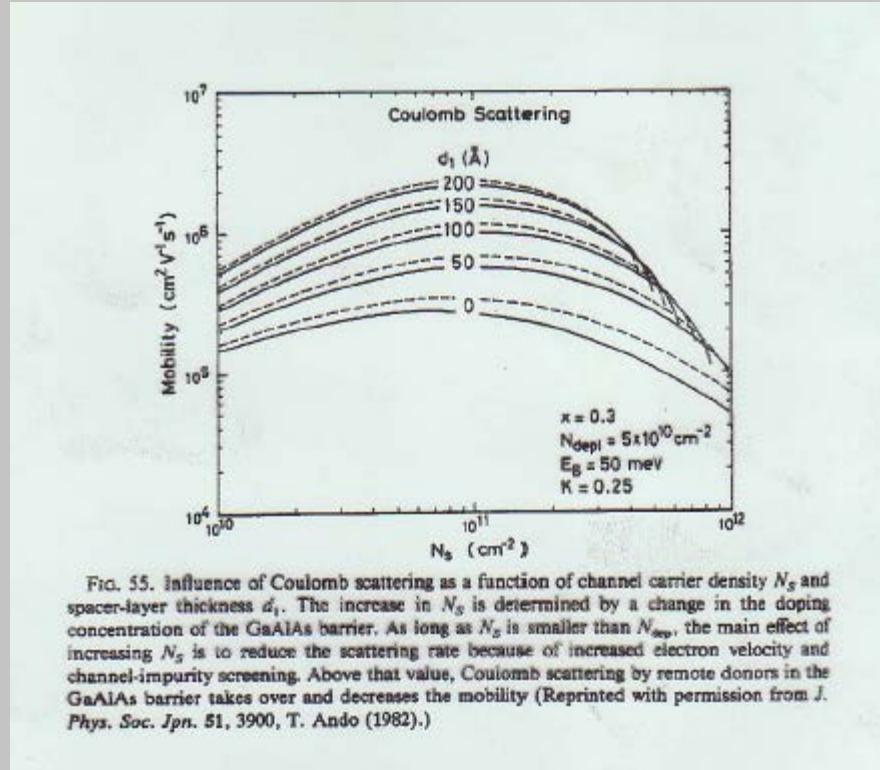
dies bedeutet aber, dass $F(q, z)$ nur von Bedeutung für kleine Winkel θ .

Die Kleinwinkelstreuung ist aber sehr wirksam bei der Impulsrelaxationszeit T_p die in die Bereglidkeit eingelst. (Vegen des Faktors $(1 - \cos \theta)$ in dem Integral des Impulsverlustes)

⇒ Kanalbereglidkeit steigt mit

$\frac{W_{sp}}{N_S}$ } ⇒ es gibt maximale Bew.

Modulationsdotierung



MODFET - HEMT

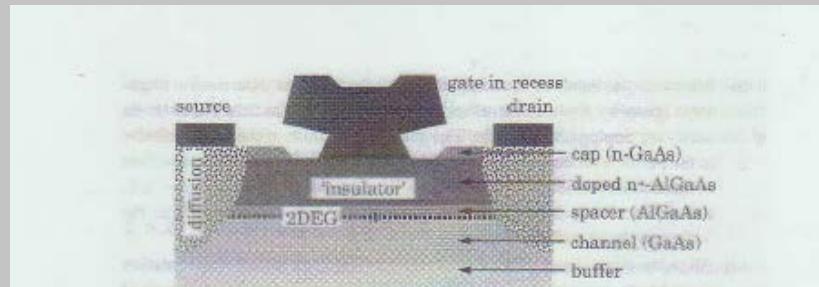


FIGURE 3.11. Simplified cross-section through a high-frequency GaAs-AlGaAs MODFET.

Anwendung der Modulationsdot.
im FET \Rightarrow MODFET

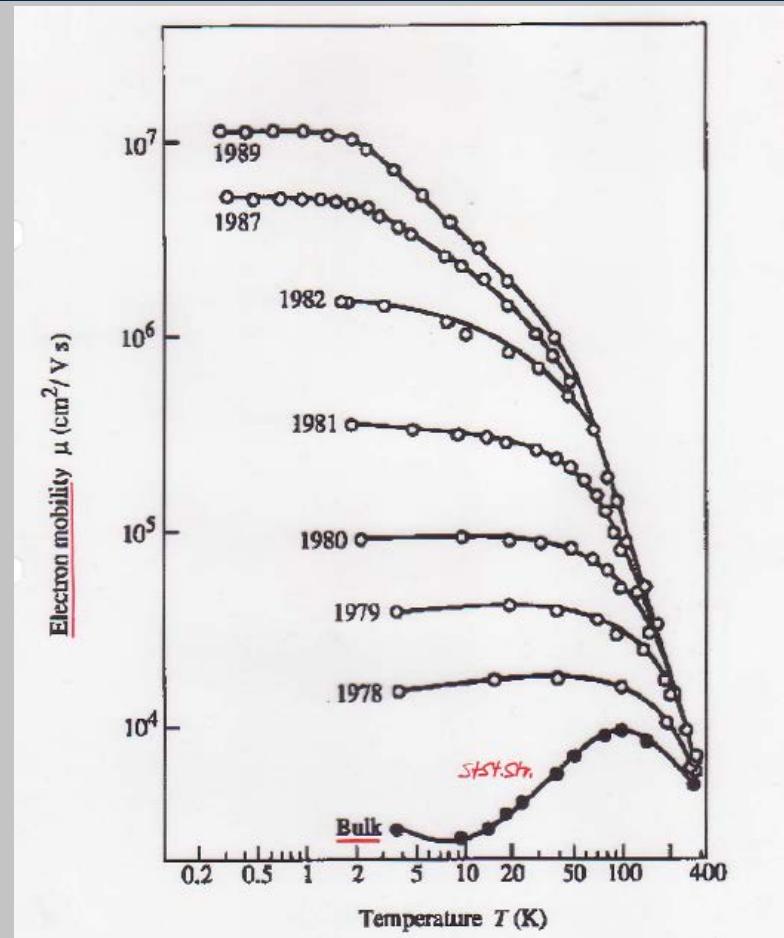
Hohe Beweglichkeit (bei RT!)

HF Bauteil (Satellitenempf.)

meist aus GaAs-AlGaAs (ΔE_c klein)
oder (ΔE_c größer)

$In_{0.5}Ga_{0.5}As$ - $In_{0.52}Al_{0.48}As$ auf InP
(strained layer)

Beweglichkeiten von MODFET



Electron mobilities in selectively doped AlGaAs/GaAs heterostructures (open circles) as a function of temperature for different years. The mobility of bulk GaAs ($N_D = 2 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, solid circles) is shown for comparison (Pfeiffer et al., 1989a).

Spacer layers

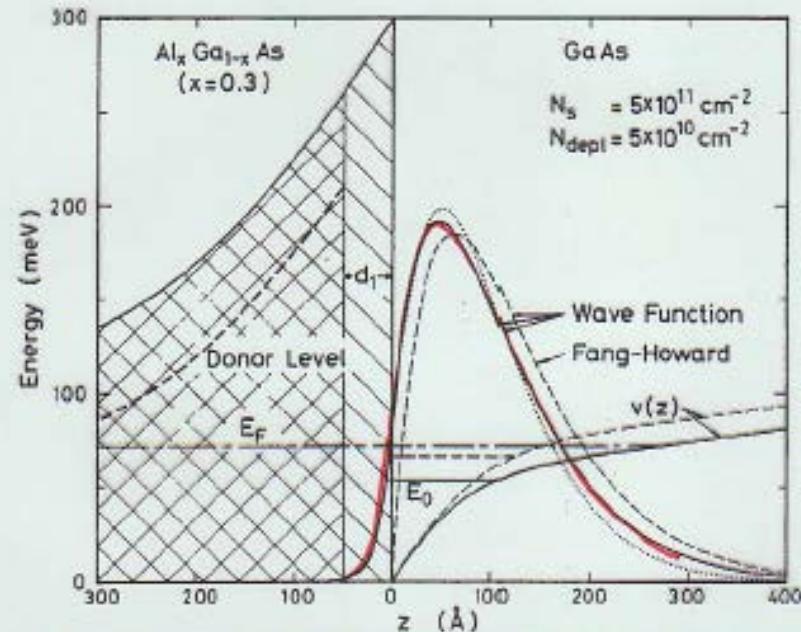


FIG. 21. Calculated energy levels and wave functions of the GaAlAs/GaAs selectively doped interface. The Fang-Howard variational wave function (no penetration in the barrier) is shown (—). The variational wave functions [Eqs. (44) and (45)] are also shown (—). The line (· · ·) represents the numerical calculation, which includes correlation effects. The different confining potentials $v(z)$ are shown. The spacer thickness is 50 Å and the donor binding energy of GaAlAs has been chosen as 50 meV (Reprinted with permission from the *J. Phys. Soc. Jpn.* **51**, 3893, T. Ando (1982).)

HEMT

Selbst konsistente Rechnung

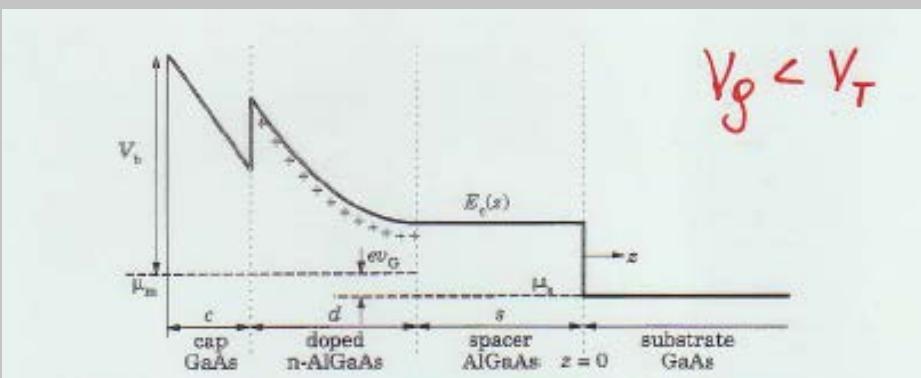


FIGURE 9.2. Band diagram through the same modulation-doped layers as in Figure 9.1 at threshold $\tau_{2D} = 0$, the Fermi level brushes $\bar{\mathcal{E}}_c$ in the channel, and $v_g = v_T < 0$. [Modelling program courtesy of Prof. G. L. Snider, University of Notre Dame.]

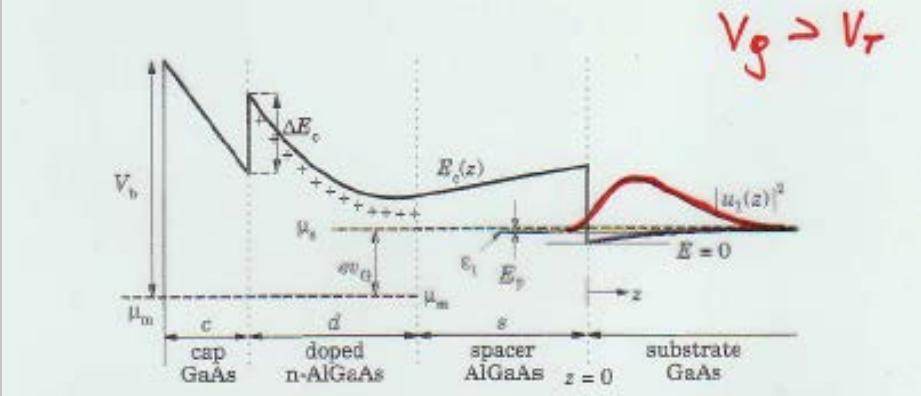


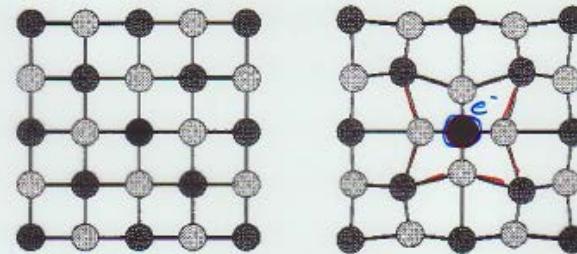
FIGURE 9.1. Self-consistent solution of the conduction band $E_c(z)$ through modulation-doped layers with a positive gate bias $v_g = 0.2\text{ V}$ and $\tau_{2D} = 3 \times 10^{15}\text{ m}^{-2}$ electrons in the 2DEG [Modelling program courtesy of Prof. G. L. Snider, University of Notre Dame.]

DX-Zentren

Donatoren im AlGaAs: DX-Zentren

In manchen HL bricht das eindimensionale Bild der H-Atom artigen Donatoren zusammen:

Die am Donator lokalisierte Ladung verzerrt das Gitter in der Umgebung

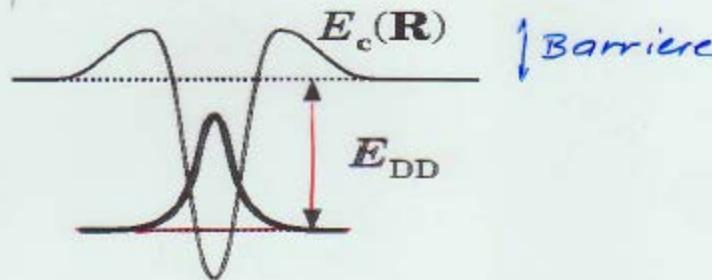


⇒ Elektron stärker gebunden
(in AlGaAs ($x=0.3$) ca. 0.12 eV)

⇒ Es entsteht eine Barriere für den Einfang der Elektronen

DX-Zentren

Insgesamt ergibt sich dann
ein st.st. Potential dieser Form

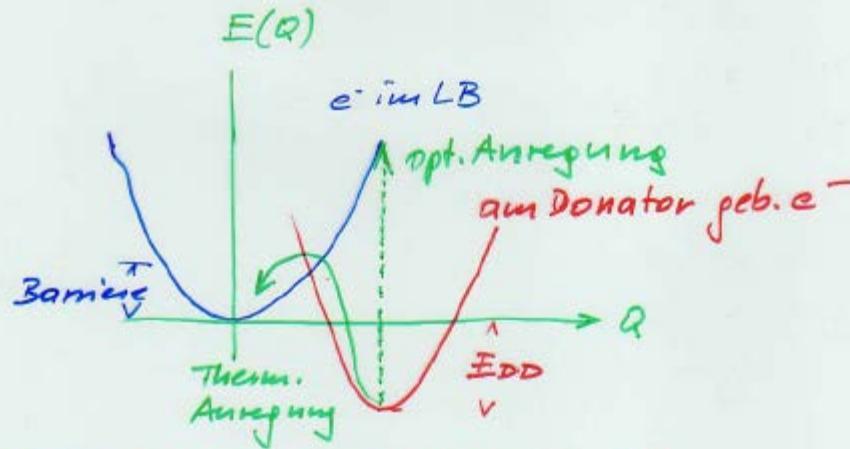


Besser ist dies im Konfigurations -
koordinaten Modell zu verstehen

DX-Zentren

Besser ist dies im Konfigurationskoordinaten Modell zu verstehen

Die Konf. Koordinate Q beschreibt eine Verzerrung des Gitters



⇒ Eintrieren der Leitfähigkeit

⇒ Persistente Photoleitung¹⁵⁹